平成30年5月10日

委　員　各　位

日本学術振興会

薄膜第131委員会

委員長　近藤高志

日本学術振興会　薄膜第１３１委員会

第284回委員会・第290回研究会開催通知

1. 日　時　：　平成30年6月7日（木）

委員会　　　　　12:00～13:00　(昼食付き)

研究会　　　　　13:00～17:20

２．場　所： キャンパス・イノベーションセンター(CIC)東京　 1階　国際会議室

 東京工業大学　キャンパス・イノベーションセンター

〒108-0023 東京都港区芝浦３－３－６　TEL　03-5440-9020

JR田町駅芝浦口から右方向の階段をおりてすぐ

東京工業大学附属科学技術高等学校正門のとなり

http://www.cictokyo.jp/access.html

３．研究会テーマ： 最先端薄膜作製技術

－AI支援ファブオペレーション、及び気相・液相を介する薄膜プロセスとin-situ観測－

1. プログラム
2. 「機械学習を用いたエッチング形状の予測と最適化」 13:00-13:40

 日立製作所　大森 健史

1. 「レシピ最適化機能・学習機能による半導体成膜装置の運用支援、及び安定稼働におけるAIテクノロジーの可能性」 13:40-14:20

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ　竹永 裕一・松井 英章

1. 「AI技術活用による半導体メモリの品質改善・生産性向上」 14:20-15:00

東芝　研究開発センター　西川 武一郎

＜　休憩　15:00～15:20　＞

1. 「VLS法による高温超伝導及び熱電変換酸化物薄膜の成長」 15:20-16:00

名古屋大学　吉田　隆

1. 「固液界面真空プロセス」 16:00-16:40

東北大学　松本祐司

1. 「QCMを用いた電極触媒層の評価解析技術」 16:40-17:20

 KRI　定塚 哲也

研究会担当委員： 森本（金沢大）、濱村（日立製作所）、浅野（九州大）、東雲（東京エレクトロン）、

北澤（シャープ）、霜垣（東京大）、八瀬（産総研）、大久保、野矢（北見工業大）、須田（名古屋大）

＜　追　記　＞

* 1. 研究会、会場等に関するお問い合わせ先

森本章治（金沢大学）TEL: 076-234-4876　E-mail: amorimot@ec.t.kanazawa-u.ac.jp

須田 淳（名古屋大学）TEL: 052-789-464　E-mail: suda@nagoya-u.jp

* 1. 研究会の参加につきましては､産業界委員が欠席される場合はなるべく代理の方に御出席いただきますようお願いいたします．また，委員の同伴者(複数名)は承認いたしますので，開催通知は関係部署に御回覧下さい．参加希望がございましたら，同伴者として氏名及び参加合計人数を御記入下さい．
	2. 準備の都合がございますので，出欠の御都合を 5月24日(木)までに日本学術振興会研究事業課 柴田 健（しばた たけしtakeshi-shibata@jsps.go.jp）からのメールの案内に従いWEB上で出欠登録して頂くかFAX (03-3263-1716) にてお知らせ下さい．
	3. 委員会に御出席の方(委員もしくは代理出席の方)には，昼食を用意いたします．出欠ご回答後にご都合により出欠を変更される場合は，御手数ですが予め御連絡をお願いいたします．

◎第１３１委員会ホームページ： http://www.sdm.ee.e.titech.ac.jp/JSPS/TF131.html

**【会場案内】**

****